



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 195 49 134 B4 2005.04.07

(12)

Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 195 49 134.3

(22) Anmeldetag: 29.12.1995

(43) Offenlegungstag: 03.07.1997

(45) Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 07.04.2005

(51) Int Cl.⁷: G01R 31/00
G01R 29/08

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden.

(71) Patentinhaber:

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, 81671
München, DE

(74) Vertreter:

Mitscherlich & Partner, Patent- und
Rechtsanwälte, 80331 München

(72) Erfinder:

Danzeisen, Klaus, Dipl.-Ing., 82166 Gräfelfing, DE;
Göpel, Klaus-Dieter, Dr.rer.nat., 80997 München,
DE; Schmidt, Werner, Dr.-Ing.habil., 09122
Chemnitz, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE 39 31 449 C2

DE 39 25 247 C2

DE 38 42 196 C2

DE 37 31 165 C2

DE 31 30 487 C2

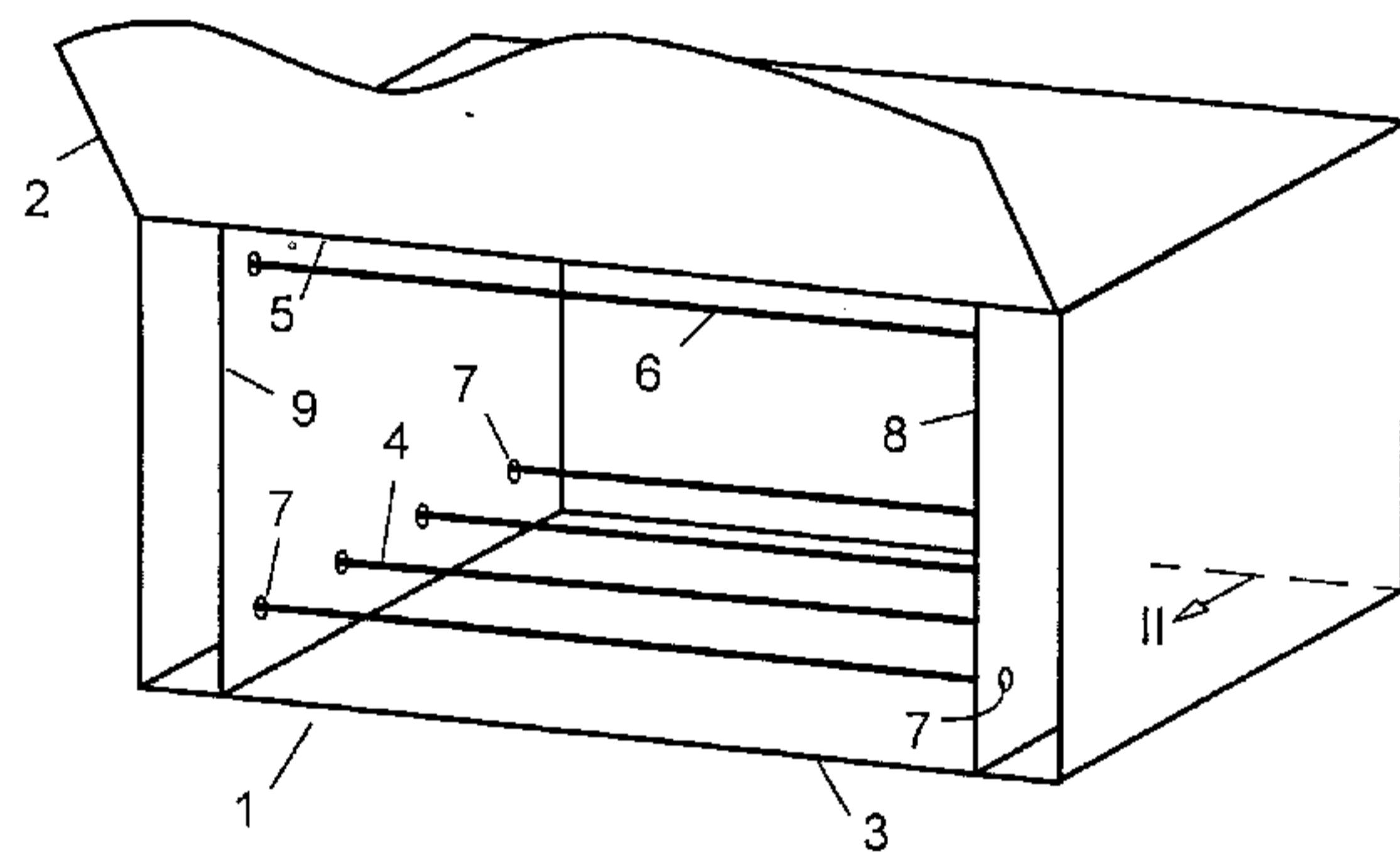
DE 43 00 778 A1

EP 05 17 992 A1

WUNDERLICH, Werner: Störfestigkeitsmessungen
an Einrichtungen zur drahtlosen
Nachrichtenübertragung mit relativ großen
Abmessungen. In: Technische Mitteilungen des
RFZ, 28. Jg., H. 1, 1984, S. 20ff.;

(54) Bezeichnung: **Vorrichtung zur EMV-Prüfung von elektrischen Geräten**

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur EMV-Prüfung von elektrischen Geräten mit einer Kammer aus leitendem Material und einer über eine Hochfrequenzquelle 13 gespeisten Einrichtung zum Erzeugen eines elektromagnetischen Hochfrequenzfeldes innerhalb der Kammer, gekennzeichnet durch mindestens zwei auf gegenüberliegenden Seiten der Kammer (1) im Abstand (a) parallel zu den Kammerwänden (3, 5) angeordnete Leiter (4, 6), die eine symmetrische Doppelleitung bilden und am einen Ende durch die Hochfrequenzquelle (13) gegenphasig gespeist und am anderen Ende über Abschlußwiderstände (11) mit den Kammerwänden (3, 5) elektrisch verbunden sind.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft und geht aus von einer Vorrichtung zur EMV-Prüfung von elektrischen Geräten laut Oberbegriff des Hauptanspruches.

Stand der Technik

[0002] Vorrichtungen dieser Art zur EMV- (Elektromagnetische Verträglichkeit) bzw. EMI- (Elektromagnetic Interference) Messung sind bekannt. Das elektromagnetische Feld in der Kammer wird bei den bekannten Vorrichtungen bisher ausschließlich durch ein unsymmetrisches Erregersystem erzeugt, bei dem die metallische Kammer den Außenleiter und eine isoliert in der Kammer gehaltene Metallplatte den Innenleiter eines Koaxialleitungssystems gebildet, das unsymmetrisch aus einer Hochfrequenzquelle gespeist ist. Um hierbei die von der EMV-Norm vorgegebene gleichmäßige Feldstärkeverteilung in der Kammer zu erzielen (die Norm verlangt, daß die Feldstärkeänderung im Prüfraum kleiner als 6 dB ist), muß die Innenleiterplatte, auf welcher der Prüfling abgestellt wird, möglichst in der Kammermitte angeordnet werden, dadurch steht aber nur der halbe Raum der Kammer für die Aufnahme des Prüflings zur Verfügung. Außerdem sind die die Norm erfüllenden EMV-Prüfvorrichtungen sehr voluminös, da für den Übergang vom koaxialen Speisekabel zu dem das Feld erzeugenden Innenleiter/Außenleiter-System eine pyramidenförmige Kammerausbildung erforderlich ist.

[0003] Es wurde zwar schon versucht, den Innenleiter möglichst nahe an der unteren Bodenwand einer quadratischen Kammer anzuordnen, dadurch wird zwar der nutzbare Raum für die Aufnahme des Prüflings vergrößert, diese bekannte Zelle erfüllt jedoch nicht die strenge Norm für die gleichmäßige Feldstärkeverteilung in der Kammer.

[0004] Aus der EP 0 517 992 A1 ist eine Vorrichtung zur EMV-Prüfung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt. Zusätzlich weist die dort beschriebene Vorrichtung parallel zu den seitlichen Kammerwänden angeordnete Leiter auf, die an einem Ende mit einer Hochfrequenzquelle und an dem anderen Ende mit Widerständen verbunden sind. In dieser Schrift wird darauf hingewiesen, dass eine bessere Feldverteilung mit einer bogenförmigen Anordnung der Leiter erreicht werden kann.

[0005] Auch die DE 39 31 449 C2 und die DE 37 31 165 C2 beschäftigen sich mit Vorrichtungen zur EMV-Prüfung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Auch dort sind einzelne Leiter im Innenraum der Vorrichtungen beschrieben. Doch bezüglich einer Anordnung der Leiter in der Weise, dass sie eine symmetrische Doppelleitung bilden, und bezüglich der gegenphasigen Einspeisung der hochfre-

quenten Testsignale ist dort aber nichts zu entnehmen.

Aufgabenstellung

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine EMV-Prüfvorrichtung zu schaffen, die bei minimalem Platzbedarf einen größtmöglichen nutzbaren Prüfraum bietet und trotzdem die nach der Norm vorgeschriebene gleichmäßige Feldstärkeverteilung in der Kammer gewährleistet.

[0007] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Vorrichtung laut Oberbegriff des Hauptanspruches durch dessen kennzeichnende Merkmale gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0008] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird das elektromagnetische Feld in der Kammer durch eine symmetrisch gegen Masse (Kammergehäuse) gespeiste Doppelleitung (Lecher-Leitung) erzeugt, deren Leiter einerseits in einem relativ großen und durch die Höhe der Kammer gebildeten gegenseitigen Abstand, jedoch in relativ geringem Abstand von den jeweils benachbarten Kammerwänden angeordnet sind. Durch die Nähe der Kammerwände baut sich auch außerhalb der Doppelleitung, also zwischen den Leitern und der Kammerwand, ein elektromagnetisches Feld auf. Dieses zwischen jedem Leiter und der benachbarten metallischen Kammerwand gebildete Leitungssystem kann als unsymmetrische offene Streifenleitung (Microstrip) betrachtet werden und es kann für dieses Streifenleitungssystem jeweils nach den hierfür bekannten Bemessungsvorschriften (Abstand des Leiters von der Kammerwand, Durchmesser bzw. Breite des Leiters und gegebenenfalls zwischen Leiter und Kammerwand vorhandenes Dielektrikum) der Wellenwiderstand berechnet werden, durch den auch der Wert des Abschlußwiderstandes zwischen Leiter und Kammerwand bestimmt ist. Es wird also für die Speisung ein infolge des großen Abstandes relativ hochohmiges Doppelleitungssystem benutzt. Die Feldstärkekonzentration im Raum zwischen Leiter und Kammerwand wird für die EMV-Messung nicht genutzt, sondern nur das elektromagnetische Feld im Raum zwischen den beiden gegenüberliegenden Leitern des Doppelleitungssystems, das mit der nach der Norm erforderlichen gleichmäßigen Verteilung für die Prüfung zur Verfügung steht. In einem praktischen Ausführungsbeispiel ist die Änderung des elektromagnetischen Feldes in der gesamten Kammer nur ± 3 dB. Trotzdem steht nahezu der gesamte Innenraum der Kammer für die Aufnahme von Prüflingen zur Verfügung und eine erfindungsgemäße Vorrichtung kann mit minimalen äußereren Gesamtabmessungen hergestellt werden.

[0009] Im einfachsten Fall wird das Doppelleitungs-

system nur durch zwei gegenüberliegende einzelne Leiter gebildet, es hat sich jedoch gemäß einer Weiterbildung der Erfindung als vorteilhaft erwiesen, auf jeder Seite mehrere nebeneinander angeordnete Leiter vorzusehen, die auf einer Seite der Kammer jeweils gleichphasig gespeist sind und so auch eine gleichmäßige Feldverteilung über die gesamte Kammerwand gewährleisten. Diese einzelnen nebeneinander angeordneten Leiter sind vorzugsweise parallel zueinander angeordnet, was jedoch nicht zwingend ist, sie könnten auch beispielsweise fächerförmig von einem zentralen Speisepunkt aus über die Kammerwand verteilt sein.

[0010] Bei mehreren nebeneinander angeordneten Leitern ist jeder über einen gesonderten Abschlußwiderstand gegen Masse (Kammerwand) abgeschlossen, die Summe all dieser Abschlußwiderstände der Doppelleitung entspricht dem Wellenwiderstand des Streifenleitungssystems. Die Doppelleitung besitzt auf diese Weise nicht mehr den relativ hochohmigen Wellenwiderstand, der sich bei einer üblichen Doppelleitung im freien Raum ausbilden würde, sondern ist durch den wesentlich geringeren Wellenwiderstand der Streifenleitungssysteme bestimmt, damit ist auch eine günstigere niederohmige eingangsseitige Einspeisung möglich. Durch unterschiedliche Dimensionierung der Abschlußwiderstände der einzelnen nebeneinander angeordneten Leiter ist es außerdem möglich, eine gewünschte spezielle Feldverteilung innerhalb der Kammer zu erzeugen, auf diese Weise kann beispielsweise in den Ecken der Kammer durch entsprechende Dimensionierung der dort wirksamen Abschlußwiderstände eine Feldverteilungsoptimierung erzielt werden. Gleicher ist durch unterschiedliche Wahl der gegenseitigen Abstände der Leiter je Leitergruppe möglich. Anstelle von jeweils getrennten Abschlußwiderständen für die einzelnen nebeneinander angeordneten Leiter könnten diese auch am Abschlußende wie bei der eingangsseitigen Speisung in einem Punkt über gleich lange Leitungen zusammengefaßt und über einen gemeinsamen Abschlußwiderstand gegen Masse geschaltet sein.

[0011] Um störende Reflexionen insbesondere im höheren Frequenzbereich zu vermeiden können auf den Innenwänden der Kammer auch noch entsprechende HF-Absorber angebracht sein, beispielsweise an den Stirnseiten, zwischen denen die Leiter der Doppelleitung angeordnet sind.

[0012] Im allgemeinen ist es für eine gleichmäßige Feldverteilung ausreichend, nur auf zwei gegenüberliegenden Kammerwänden die Leiter einer Doppelleitung anzurichten, für spezielle Anwendungsfälle kann es jedoch auch zweckmäßig sein, an drei oder vier Seiten der Kammer jeweils solche Doppelleitungssysteme anzubringen, also beispielsweise am Boden und der Decke der Kammer ein erstes Doppelleitungssystem und an den gegenüberliegenden Seitenwänden ein zweites Doppelleitungssystem.

Ausführungsbeispiel

[0013] Die Erfindung wird im folgenden anhand schematischer Zeichnungen an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.

[0014] **Fig. 1** zeigt perspektivisch die Gesamtansicht einer erfindungsgemäßen EMV-Prüfzelle mit einer quaderförmigen Kammer 1 aus Metallblech mit einer Seitenlänge von beispielsweise 1 bis 2 Meter zur Aufnahme eines nicht dargestellten elektrischen Gerätes, dessen elektromagnetische Empfindlichkeit nach der EMV-Norm gemessen werden soll. Die eine Seitenwand der Kammer 1 ist als Klapptür 2 ausgebildet. Am Boden der Kammer sind im Abstand a und parallel zur Bodeninnenwand 3 mehrere, im Ausführungsbeispiel vier Leiter 4 angeordnet und an der Kammerdecke in gleicher Weise im Abstand a parallel zur Deckeninnenseite 5 mehrere Leiter 6, wie das Schnittbild nach **Fig. 2** zeigt. Die Leiter 4, 6 sind beispielsweise als Drähte ausgebildet, die zwischen Durchführungen 7 aus Isoliermaterial gespannt sind, die an stirnseitigen Zwischenwänden 8, 9 der Kammer befestigt sind. Falls erforderlich, können zwischen den Kammerwänden 3, 5 und den Leitern 4, 6 auch noch zusätzliche Isolierstützen angeordnet sein. Die Leiter 4, 6 werden, wie das Prinzipschaltbild nach **Fig. 3** zeigt, am einen Ende über eine Speiseanordnung 10 mit gegenseitiger 180°-Phasenverschiebung gespeist und ihr anderes Ende ist jeweils über einen Abschlußwiderstand 11 mit den metallischen Kammerwänden (Masse M) verbunden. Die Speiseanordnung 10 ist beispielsweise über ein Koaxalkabel 12 mit einem Hochfrequenzsender 13 verbunden, über den in der Kammer ein elektromagnetisches Feld mit einer Frequenz beispielsweise zwischen 80 MHz und 1 GHz erzeugbar ist. Die über das Koaxalkabel 12 unsymmetrisch zugeführte Hochfrequenzleistung wird über einen Symmetrierübertrager 14 in der Speiseanordnung 10 gegen Masse M symmetriert und dann über eine Verteilerschaltung 15 bzw. 16 mit gleich langen Verteiler-Leitungen den einzelnen Leitern 4 bzw. 6 zugeführt. Die beiden gegenüberliegenden Leitergruppen 4, 6 bilden elektrisch eine symmetrische Doppelleitung, die aus dem Symmetrierübertrager 14 gegenphasig und symmetrisch gegen Masse M (Kammer 1) gespeist ist. Gleichzeitig bildet jede Leitergruppe 4 bzw. 6 mit der ihr gegenüberliegenden Kammerwand 3 bzw. 5 ein unsymmetrisches Leitungssystem, dessen Wellenwiderstand im wesentlichen durch den Abstand a der Leiter gegenüber der Kammerwand bestimmt ist. Die Abschlußwiderstände 11 sind entsprechend diesem Wellenwiderstand des unsymmetrischen Leitungssystems dimensioniert. Der Wellenwiderstand der Doppelleitung 4, 6 ist infolge des relativ großen gegenseitigen Abstandes – bestimmt durch die Größe der Kammer – relativ groß

in der Größenordnung von mehreren KΩ während der Wellenwiderstand der unsymmetrischen Leitungssysteme **3**, **4** bzw. **5**, **6** in der Größenordnung von 50 bis 200 Ω liegt. Durch das funktionelle Zusammenwirken dieses symmetrischen Speisesystems mit den unsymmetrischen Leitungssystemen wird also die Doppelleitung mit relativ niederohmigen Abschlußwiderständen (Wellenwiderstand der Streifenleitung) abgeschlossen und der parallel dazu liegende relativ hochohmige Wellenwiderstand der Doppelleitung kann bei der Dimensionierung des Abschlusses vernachlässigt werden. Eingangsseitig wirken die dem Wellenwiderstand der Streifenleitung entsprechenden Abschlußwiderstände in Reihe und bilden einen für die Speisung günstigen ebenfalls relativ niederohmigen Eingangswiderstand. Auf diese Kombinationswirkung ist die extrem gleichmäßige Feldstärkeverteilung innerhalb der Kammer zurückzuführen.

[0015] Die Abschlußwiderstände **11** sind vorzugsweise im Raum zwischen der stirnseitigen Zwischenwand **8** und der Stirnwand der Kammer **1** angeordnet, die Speiseanordnung **10** in dem Raum zwischen der stirnseitigen Zwischenwand **9** und der Kammerwand auf der gegenüberliegenden Seite.

[0016] Über der Leitergruppe **4** ist vorzugsweise noch ein schematisch angedeuteter Zwischenboden **17** zum Abstellen der Prüflinge vorgesehen.

[0017] Um störende Reflexionen insbesondere im höheren Frequenzbereich zu vermeiden können auf der Innenseite der Kammerwände noch zusätzliche HF-Absorber **18** angebracht sein, wie dies schematisch auf der Stirnzwischenwand **8** dargestellt ist. In gleicher Weise können auf der speiseseitigen Stirnwand **9** und gegebenenfalls auch auf den Seitenwänden entsprechende Absorber angebracht werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur EMV-Prüfung von elektrischen Geräten mit einer Kammer aus leitendem Material und einer über eine Hochfrequenzquelle **13** gespeisten Einrichtung zum Erzeugen eines elektromagnetischen Hochfrequenzfeldes innerhalb der Kammer, gekennzeichnet durch mindestens zwei auf gegenüberliegenden Seiten der Kammer **(1)** im Abstand (a) parallel zu den Kammerwänden **(3, 5)** angeordnete Leiter **(4, 6)**, die eine symmetrische Doppelleitung bilden und am einen Ende durch die Hochfrequenzquelle **(13)** gegenphasig gespeist und am anderen Ende über Abschlußwiderstände **(11)** mit den Kammerwänden **(3, 5)** elektrisch verbunden sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Abschlußwiderstände **(11)** so dimensioniert sind, daß sie dem zwischen den Kammerwänden **(3, 5)** und den Leitern **(4, 6)** gebildeten

Wellenwiderstand entsprechen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß auf jeder Seite der Kammer **(1)** im Abstand parallel zur Kammerwand **(3, 5)** jeweils mehrere gleichphasig gespeiste Leiter nebeneinander angeordnet sind (Leitergruppen **4** bzw. **6**).

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die gegenseitigen Abstände der Leiter **(4, 6)** und/oder die Abschlußwiderstände **(11)** im Sinne einer vorbestimmten Feldstärkeverteilung unterschiedlich dimensioniert sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Innenseite von mindestens einer Seitenwand der Kammer **(1)** Hochfrequenz-Absorber **(18)** angebracht sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

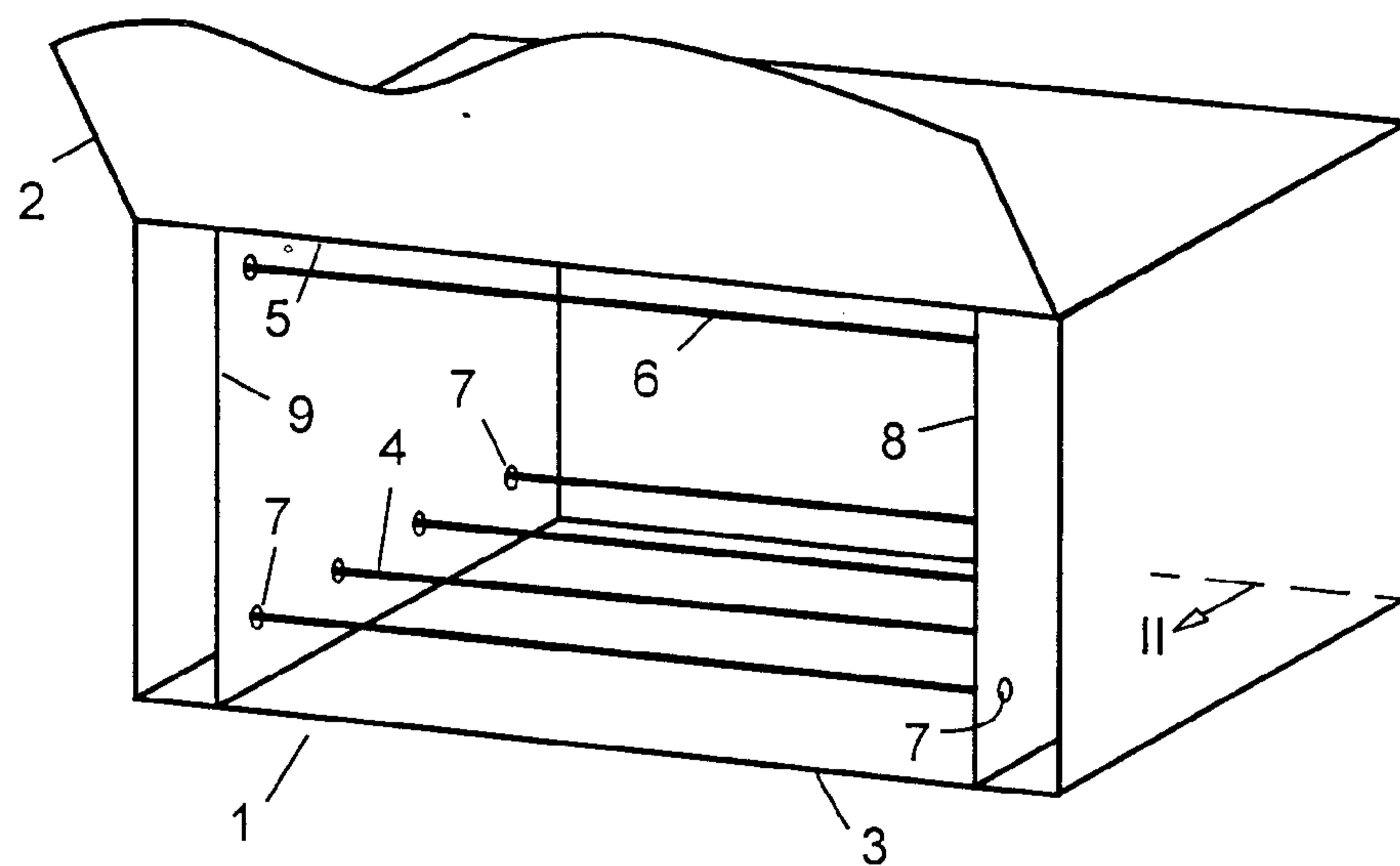


Fig. 1

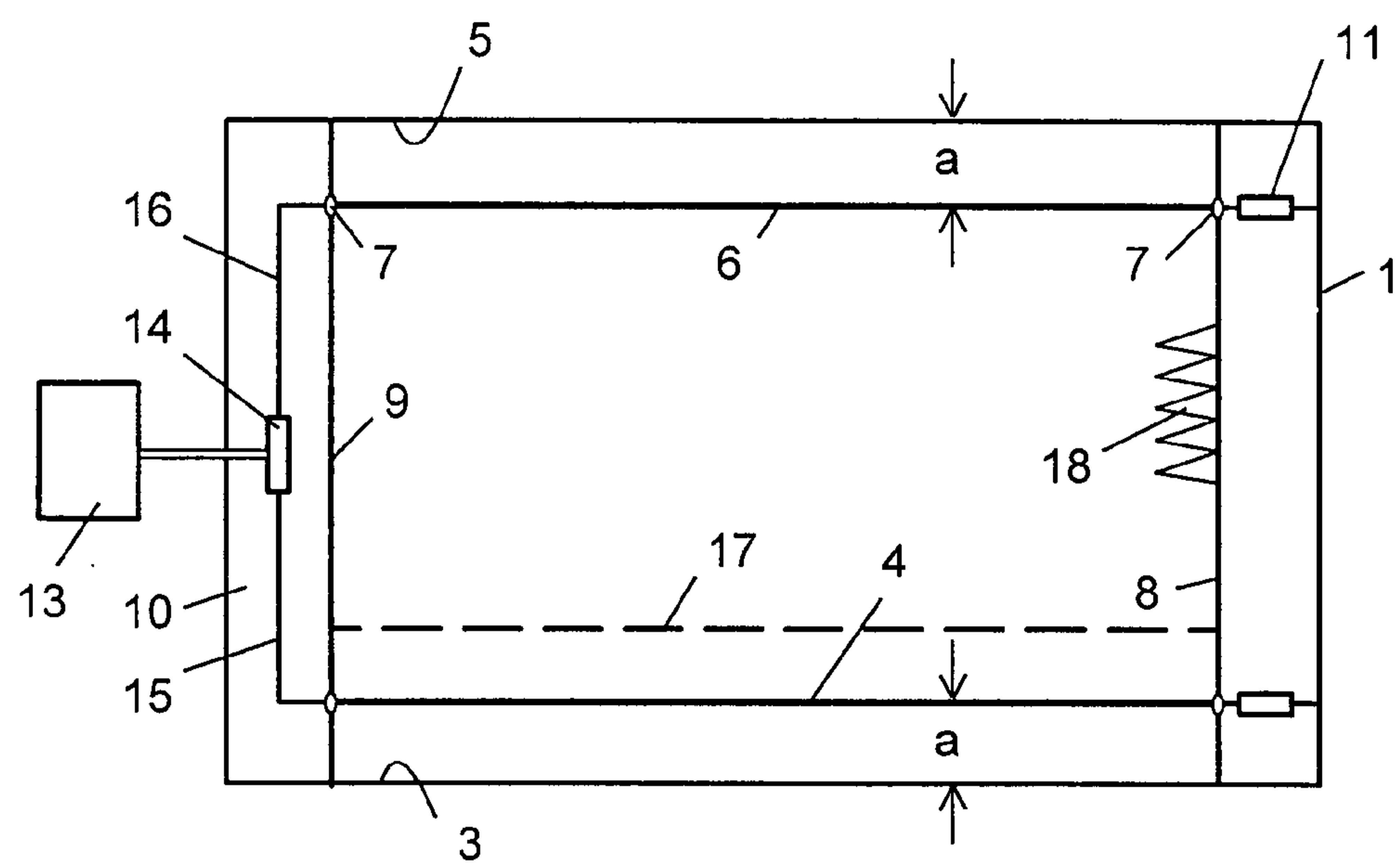
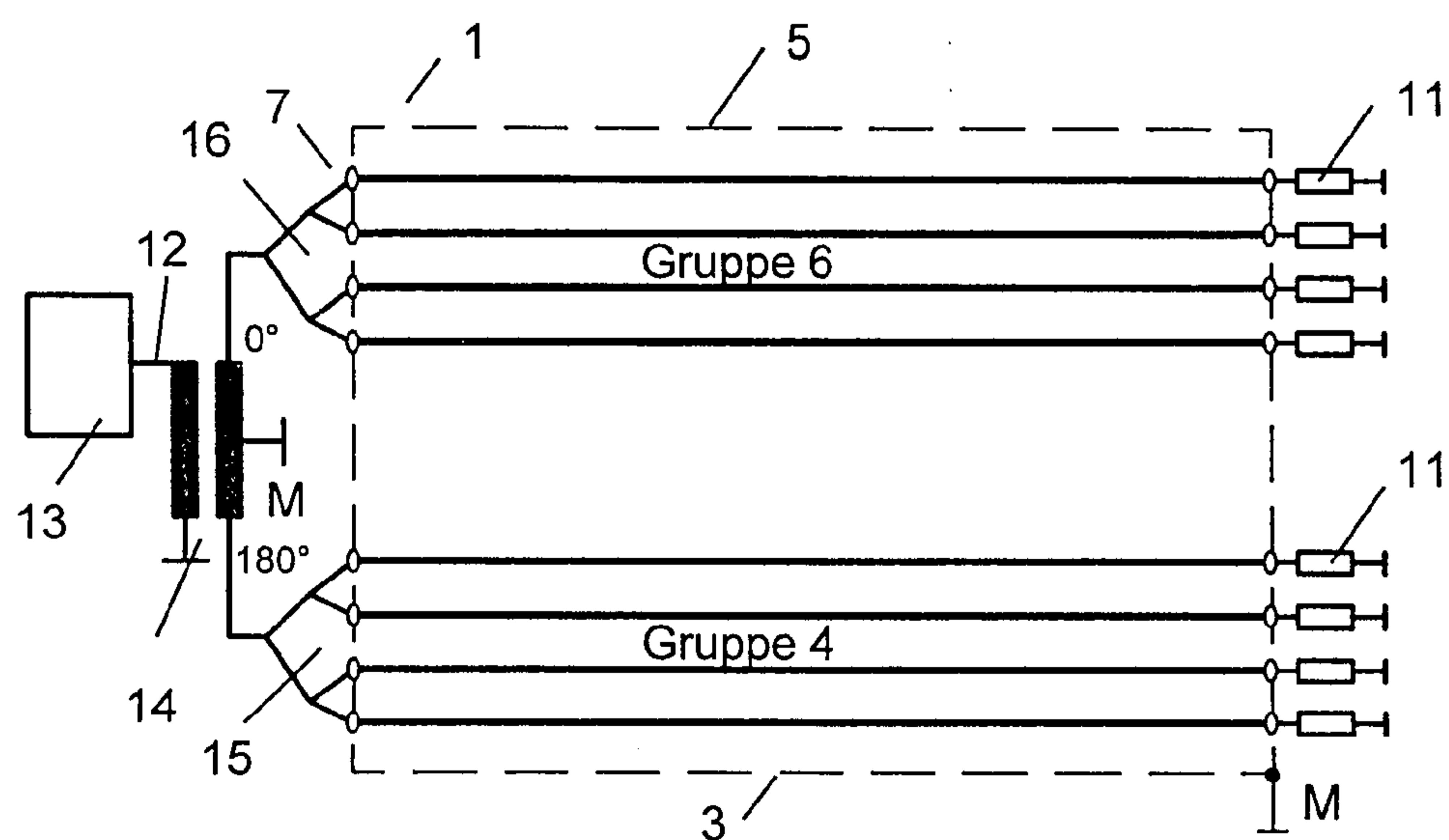
Fig. 2
Schnitt II

Fig. 3